

DIN 50455-2:1999-11 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	1
2 Normative Verweisungen	1
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens	1
4 Formelzeichen und Einheiten	1
5 Definitionen	2
6 Geräte und Materialien	2
7 Durchführung	3
7.1 Allgemeines	3
7.2 Auftragung des Fotolackes	3
7.3 Belichtung	3
7.4 Entwicklung	3
8 Auswertung	3
9 Präzision des Verfahrens	3
10 Prüfbericht	4